

미국-일본, 특허 동시심사 합의

미국과 일본은 양국에 출원된 특허에 대해 거의 동시에 심사를 통해 특허를 부여하는 새로운 제도를 도입하기로 합의했다.

일본 특허청과 미국의 특허상표청은 특허의 내용과 심사 정보를 사전에 공유해 사실상 양국이 공동으로 특허를 부여하는 체제를 갖추게 된다.

미-일 양국은 2008년 가을부터 일부 첨단 분야에서 신 제도를 시험적으로 실시한 후 2009년 이후 대상 분야를 확대할 방침이다. 양국 특허당국은 심사정보를 사전에 공유하기 위해 시스템을 상호 접속하게 된다.

제도가 성공하면 비슷한 움직임이 세계 각국으로 확대될 것으로 전망되고 있다.

<화학저널 2008/09/26>